

OTFC-1300 规格例



设备名称	OTFC-1300C/D
真空室	SUS304, ϕ 1300mm \times 1610mm(H)
工件架	ϕ 1150mm
工件架转速	5rpm to 50rpm(可变)
光学膜厚控制	Hom2-R-VIS350A 型光学控制 波长范围: 350nm to 1100nm 反射式/透射式
水晶式膜厚计	XTC/2+6 点式水晶传感器
蒸发源	电子枪 2 套
离子源	17cmRF 离子源
排气系统	机械泵+2 个扩散泵+Polycold (或 2 个冷凝泵)
性能	
达到压力	9.0×10^{-5} Pa 以下
排气时间	30 分 (大气压 \sim 1.3×10^{-3} Pa)
基板温度	最高: 350 $^{\circ}$ C
工作条件	
设备尺寸	约 6000mm(W) \times 7500mm(D) \times 3500mm(H)
电源	3 相,200v,50/60Hz, 约 95KVA
水流量	100 升/分以上
空气压力	0.5MPa 以上
重量	约 6000kg